



Рис. 7. Зависимость среднеарифметической (R_a) и среднеквадратичной (R_q) шероховатости от содержания наночастиц диоксида кремния в композиционных пленках состава ПММА – SiO_2 , сформированных на гидрофилизированных предметных стеклах (*a*) и кремниевых пластинах (*б*)

Fig. 7. Dependence of the arithmetic mean (R_a) and root mean square (R_q) roughness on the content of silicon dioxide nanoparticles in composite films of the composition PMMA – SiO_2 formed on hydrophilised glass slides (*a*) and silicon wafers (*b*)